

高真空蒸着装置 RD-1350



高真空蒸着装置RD-1350は金属成膜用抵抗加熱式蒸着装置です。本装置はクリーンルーム設置用に開発された装置で、排気系はオイルフリー仕様のドライポンプとターボ分子ポンプを採用しております。また窒息防止対策、漏水対策、エア圧力・水圧の異常も監視しております。装置の操作は初心者オペレーターにも簡単に操作出来るよう、排気系の立ち上げ、立ち下げ、蒸着準備、ベントを自動で行い、成膜制御も水晶振動式膜厚計により自動で行います。

高真空蒸着装置 RD-1350 仕様

- 到達圧力 5.0×10⁻⁴Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 φ350mm×350mmH水冷パイプ巻 SUS304 電解研磨
- 開閉方法 エア駆動による上下開閉
- 蒸着機構 抵抗加熱方式1対(ポート)
AC10V0~400A
- 基板形状 □30mm 1枚
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 基板加熱 ハロゲンランプ1.0kW×1式
常温~300℃迄昇温可能
ヒーター制御:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 真空排気系 ドライポンプ:233/267L/min[50Hz/60Hz]
ターボ分子ポンプ:190L/sec
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 制御系 ターボ分子ポンプパワーサプライ/デジタル温調計/プログラムコントローラ(蒸着制御)
- 操作方法 手動/自動(排気系立ち上げ/蒸着準備/ベント/排気系立ち下げ:4種類)
グラフィックパネル、液晶表示アラームディスプレイ
- ユーティリティ 電気: AC200V三相10kVA
冷却水: 7L/min0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
計装エア: 0.5MPa以上
寸法: 装置架台本体: 900mmW×850mmD×(1875)mmH
制御盤: 570mmW×630mmD×(1600)mmH